濟 部智慧財產局專 利 再審 核 縣 理 由 先行 通 知 書

37

受 文 者: 清福 先生) 大新工業股份有限公司 '(代理 人:

地 址 台北市忠孝東路一段一七六號九

發發 (文文號:) (文) 第〇八九八二〇〇五六〇四號〈 八九〉智專三(四)01021字中華民國八十九年十一月三 日

主 旨 件 公 (司) 若有 壹仟 內 O 本 註 案 太 元 明 多 正 申 有 具 0 若限 修正 體 九 請 反 面 七 應 證 期 詢 0 資料 內 繳 修正却 修 不 號 提 或 專 規費新 出 說 利 申 認為有必 明 再 復 ٠, 審 台幣三百 請 查 於 案 要時,另安排 文到 經 不得要求 元次 占 正 日 後 起 0 延 六 現 期地 若 十 點 希 日 望 內 如 時間舉 來 依 局 出 現 當 申 欄 有 辨 面復 腁 示 說 一面 述 範 明 詢 及 或 明 有 明 關 之 定 並 反 缴 請 證 交規 於 資料 以 免本 申 費 復 端 說明二 新 X06

說 明

利用 4793283及USP 4795880就 案 氟 **飛系氣體** 清潔氣 也或 氮系 八體」 係に 氣 揭 體 示 做 以CF3CF=CF2等氣體做為清潔CVD管腔的氣體 為清潔CVD管腔 揭 示 ,故本案所請不具進步性 的 清潔氣體,是一 種常見的方法, 以達清潔CVD管腔之目的 如 附件一、二USP

Ξ 本案係運用申 十條第二項之 規定 請前 既 應 有 不 Ż 予專 技有 術所 或 利 知 識 而為熟習該 項技術者 所能 輕易完成者 , 亦 不 符專 利 法 第二

0

四 另本國專 權 日 (或申請 利 第三四 日)要晚 七 四 但 六 及 內容完全相同 第三 O ニニの , 也是日本 五 號 如 附 電子公司所 件 Ξ , 四 申 請 雖 然 而 公 告 申 請 日 的 期 日 比 本 期 案 比 本 的 案 優 先

道 法 89. 11.

第一 頁

申請日期早很多,故本案所請仍不具新穎性

經濟部智慧肝產局

第二頁

c:\A8900318.955

割

1,0

Mr. SAITO
Saegusa International Patent Office

English Translation of the Office Action (Issued to Taiwanese Patent Application No. 086109701)

Subject:

After examining the patent application No. 086109701, there are several unclear points in the application as described in the following descriptions. If the applicant has any substantial rebuttal documentation or descriptions, please submit the response and the relative rebuttal documentation in duplicate (with the payment of NT\$ 300 official fee, if there are amendments) within 60 days from the date following receipt of this Action. If the applicant wants to come to the Office to demonstrate or describe, please annotate "petition for interview" in the response, and the Office will arrange the place and the time to hold the interview, if considered necessary, and the applicant should pay the official fee NT\$ 1000. If failure to submit the response in the statutory period, the applicant will not be allowed to request an extension, and the Office will examine based on the material on file in order that the Office will not have too much backlog.

Descriptions:

- 1. The present application entitled "Cleaning Gas" is related to cleaning gases, such as CF3CF=CF2, for cleaning a CVD tube, thereby achieving an object of cleaning the CVD tube.
- 2. The fluorine-containing gas or nitrogen-containing gas is widely used as the cleaning gas for cleaning CVD tube. See USP 4,793,283 and USP 4,795,880. Therefore, the present application does not have progressiveness.
- 3. The present application is easily achievable by the person skilled in the art. According to the Article 20(2) of the Patent Law, an invention patent shall not be granted thereto.
- 4. Although the publication dates of Taiwan Patent Publication Nos. 347,416 and 302,305 are later than the priority date (or filing date) of the present application, they are the same as the present invention, their assignees are Japanese corporations and their filing dates are much earlier than that of the present invention. Thus, the present application is in lack of novelty.

/. >

THIS PAGE BLANK (USPTG)